

令和4年2月21日

於・特許庁庁舎9階庁議室＋Web会議室

産業構造審議会知的財産分科会
令和3年度第1回審査品質管理小委員会
議事録

特 許 庁

目 次

1. 開会		1
2. 議題 1	審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案）について	5
3. 議題 2	審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について	14
4. 議題 3	ユーザー評価調査結果から見た審査関連施策について	28
5. 閉会		37

開 会

○船越品質管理室長 おはようございます。品質管理室長の船越でございます。定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会令和3年度第1回審査品質管理小委員会を開催いたします。本日は御多忙の中、御出席いただきましてまことにありがとうございます。

特許庁では昨年度の本小委員会でいただいた評価・改善提言を踏まえて、審査の質の維持・向上に取り組んでいるところでございます。今年度も評価・改善提言をいただき、審査品質管理の実施体制の充実、審査の質の継続的改善に向けて、引き続き委員の皆様の御意見を賜りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

本日、一部の委員はWeb会議システムによる御出席となっております。この会議室に御出席の方とWeb会議システムによる御出席の方とは、リアルタイムに音声のやりとりができるようになっております。

御発言の際、この会議室に御出席の方は挙手していただき、指名されましたらマイクのボタンを押して御発言ください。御発言が終わりましたら、再度ボタンを押してマイクを切っていただくようお願いいたします。

Web会議システムによる御出席の方は、挙手機能をお使いいただくか、御発言希望の旨をチャット欄に御記入いただき、指名されましたらマイク及びカメラのアイコンをオンにして御発言ください。御発言が終わりましたら、アイコンをオフにいただくようお願いいたします。通信環境等の問題がありましたら、カメラのアイコンはオフのままでも結構です。

音声聞こえないなど、何かトラブルが発生しましたらチャット欄に御記入ください。係の者が対応いたします。

委員長挨拶

○船越品質管理室長 議事に先立ち、委員長選任の御連絡をさせていただきます。本小委員会の委員長は産業構造審議会運営規則に基づき、益一哉知的財産分科会長より井上由里子委員を引き続き御指名いただいております。つきましては、井上委員長から一言御挨拶をお願いいたします。

○井上（由）委員長 お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
特許庁における審査の質は、産業財産権制度を活用した事業の予見性に多大な影響を及ぼし得るものでございまして、その維持・向上は極めて重要でございます。皆様方の御協力をいただきまして、特許庁の審査品質管理の充実に貢献し、特許制度利用者の皆様が円滑に事業を進められるようにできたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

本小委員会では平成 26 年度より、特許庁における審査に関し、品質管理の方針や手続が適切に整備されているかどうか、品質管理体制が適切に整えられているかどうか、方針や手続に沿った品質管理が適切に実施されているかといった点について評価をいたしまして、それらの改善に向けた提言を行ってまいりました。

今年度第 1 回目となります本日の小委員会におきましては、今年度の審査品質管理の実施体制、実施状況に関する評価を行います。そして、改善提言に向けた議論もいたしたいと思っております。

また、これに加えて、これまでのユーザー評価調査結果、審査関連施策の報告も予定しております。委員の皆様におかれましては、特許庁の審査品質管理のさらなる充実に向けて活発な御発言をお願いいたします。

以上、簡単ではございますが私からの挨拶とさせていただきます。

○船越品質管理室長 井上委員長、ありがとうございました。

以降の議事進行を井上委員長にお願いしたいと存じます。井上委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

委員の紹介

○井上（由）委員長 それでは初めに、事務局から委員の御紹介と配布資料の確認をお願いいたします。

○船越品質管理室長 それでは、本小委員会の委員の皆様を五十音順に御紹介させていただきます。

本日は、日刊工業新聞社執行役員編集局長・井上渉委員。

北浜法律事務所弁護士・大須賀滋委員。

日本国際知的財産保護協会副会長・近藤健治委員。

特許事務所サイクス弁理士・菅原峻一委員。

日本知的財産協会理事長・別宮智徳委員。

本多国際特許事務所弁理士・本多敬子委員に御出席いただいております。

別宮委員におかれましては、今年度新たに委員に御就任いただきました。お一言いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○別宮委員 御紹介いただきました別宮でございます。聞こえておりますでしょうか。

○船越品質管理室長 はい、聞こえております。

○別宮委員 日本知的財産協会の理事長を務めております。今年度からこの委員会に参加させていただくことになりました。所属勤務先は日産自動車になります。よろしくお願いいたします。

○船越品質管理室長 別宮委員、ありがとうございます。

なお本日は、電気通信大学大学院情報理工学研究科教授・田中健次委員、杉村萬国特許法律事務所弁理士・村松由布子委員が御欠席です。

本日は、議決権を有する9名の委員のうち7名の御出席をいただいておりますので、産業構造審議会令第9条に基づき、本日の小委員会は成立となります。

配布資料の確認

○船越品質管理室長 次に、配布資料の確認をさせていただきます。

この会議室においては、お手元のタブレットに資料を格納させていただいております。タブレットの使用方法については、お手元に「タブレットの使い方」というペーパーがございますので、そちらを御参照ください。Web 会議システムによる御出席の方は、事前に御案内させていただいた資料を御覧ください。

本日の配布資料は、議事次第・配布資料一覧、委員名簿、資料1－1から1－3は、令和2年度改善提言に関する特許・意匠・商標審査の取組状況。資料2－1から2－3は、各評価項目についての特許・意匠・商標審査の実績・現況。資料3は、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案）。資料4は、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案。資料5は、ユーザー評価調査結果から見た審査関連施策。

参考資料1は、審査品質管理に関する評価項目及び評価基準。参考資料2は、令和2年度における品質管理の実施体制・実施状況に関する改善提言です。

また、委員用の資料もお渡ししており、委員用資料1は品質関連指標、委員用資料2は各委員の評価結果となっております。

本日、一部の委員はWeb会議システムによる御出席となっております。資料3から4に関する事務局からの説明につきましては、資料3から4のレイアウトを投影用にさせていただきます、会議室のスクリーン及びWeb会議システムにおいて表示させていただきます。

続きまして、議事の公開についてです。本小委員会では新型コロナウイルス感染症拡大防止、サーバー負荷軽減等のため、一般傍聴及びリアルタイムでの公開は取りやめとさせていただきます。議事録と議事要旨、配布資料についてはこれまでと同様、特別の事情に該当する場合を除き、特許庁のホームページにおいて公開させていただきます。議事録については、委員の皆様方に後日内容を御確認いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

○井上（由）委員長 ありがとうございました。

長官挨拶

○井上（由）委員長 それでは、本小委員会の開催に当たりまして、森長官から一言御挨拶をお願いいたします。

○森特許庁長官 井上委員長、また委員の皆様、お忙しいときに出席くださりましてありがとうございます。長官の森でございます。一言挨拶させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響によって社会全体が大きく変わって、新たなニーズが顕在化しています。それに伴い、新しいビジネス拡大のためのイノベーションが重要になります。そのようなイノベーションを促すべく、特許庁は迅速、高品質な審査に取り組んでおります。高品質な審査を支える品質管理の取組の充実には、ユーザーの皆様のニーズや期待の適切な把握が不可欠との認識のもと、審査の質についてのユーザー評価調査を実施してまいりました。

中でも、特許のユーザー評価調査は長い実績を有しており、このたび10年目を迎えたわけでございます。品質管理の取組を一層強化すべく、本小委員会を平成26年に設置し、品質管理の実施状況、実施体制について有識者の皆様による客観的な評価と、さらなる改善に向けた御提言をいただいております。今後も審査の質の維持・向上に努めてまいりますので、本日は審査の品質管理について、ぜひ忌憚のない御意見を頂戴できれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

○井上（由）委員長 長官、ありがとうございました。

議題 1 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案）について

○井上（由）委員長 それでは、議題に入らせていただきます。最初の議題は、「審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案）について」でございます。

各委員には、事務局から事前に説明がありました資料 1－1 から 2－3 に基づいて、あらかじめ評価をいただいているところでございます。資料 3 に基づきまして評価結果（案）を、事務局から説明をお願いいたします。

○船越品質管理室長 ありがとうございます。資料 3 は、各委員の評価を事務局で取りまとめた案です。

まず、資料構成について御説明します。委員の皆様には評価項目①から評価項目⑪まで、それぞれ「極めて良好」「良好」「概ね達成」「改善を要す」の 4 つの中から評価いただいております。資料 3 では例年どおり、各委員の評価の中央値を本小委員会の評価結果（案）として御提示させていただき、また、その他のいただいた評価も記載しております。

「何々との評価もあった」という記載が末尾にある場合は、その評価をお一人からいただいていることを示しており、「何々との評価も複数あった」という記載が末尾にある場合は、その評価を 2 名の委員の方からいただいていることを示しており、また、「何々との評価も多くあった」という記載が末尾にある場合は、その評価を 3 名または 4 名の委員の方からいただいていることを示しております。

さらに、評価項目ごとに事前にいただいた委員の皆様の御意見について、御評価いただいた点と今後期待される点とを、重複する御指摘をまとめつつ、なるべくそのまま列記しております。

資料 3 の最終 27 ページの表を御覧ください。この表は特許、意匠、商標審査の品質管理に関する評価の中央値を一覧で示したものです。評価項目①から③は、特許、意匠、商標とも「極めて良好」。評価項目④は、特許、意匠、商標とも「概ね達成」。評価項目⑤から⑪は、特許、意匠、商標とも「良好」でした。

それでは資料 3 について、まず特許から御説明します。なお、評価の中央値が「極めて良好」であります評価項目①から③につきましては、説明を割愛させていただきます。

資料３の３ページの上段を御覧ください。評価項目④：審査実施体制でございます。中央値は「概ね達成」でした。

評価された点として、審査の効率の視点で不断の改善が行われている点、ＡＩ・ＩｏＴ関連発明について、審査環境を整備している点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、国際的に遜色のない水準の審査官数を確保しているとまでは言えない点、世界最高水準の審査体制に向けて、審査官の能力向上だけでなく、審査へのＡＩ技術の活用の実現を期待する点などの御意見をいただきました。

評価項目⑤：品質管理体制でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、テレワークを活用した品質管理のための体制の効率化・最適化が進んだ点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、品質監査結果のフィードバックを受けた各審査部・審査長単位において、審査官の指導が適切に行われることを期待する点、諸外国の品質管理体制と比較検討し、日本が取り入れていくべき点を明らかにする姿勢が望まれる点の御意見をいただきました。

評価項目⑥：品質向上のための取組でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、品質向上のために必要とされる各種取組が計画、実施されている点、オンライン面接に利用可能な Web 会議サービスを拡充し、テレワーク中の審査官がユーザーに電話連絡できる手段を整備した点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、オンライン面接をさらに活用していくことが望まれる点、登庁制限下にあってもオンライン等による協議を積極的に行われることが望まれる点などの御意見をいただきました。

評価項目⑦：品質検証のための取組でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、ユーザー調査評価調査について、「やりっぱなし」ではなく、検証結果を品質向上につなげる着実な取組がなされている点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、ユーザー側のみならず、審査官側の認識調査でも品質検証を行ってはどうかという点、海外企業、中小企業等の多岐にわたるユーザーとの意見交換を継続、拡充することを期待するという点などの御意見をいただきました。

評価項目⑧：審査の質の分析・課題抽出でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、品質監査等のデータ収集・分析を通じて得られた気づきを集約し、審査の質の分析と課題抽出が適切に行われている点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、サーチは審査の前提をなす情報であり、サーチ手段充実のための予算の手当も含めて積極的に取り組まれることを期待する点、審査の質の分析の具体的手段については確立されているものの、より具体的な課題に向けてもう少し掘り下げることを期待する点などの御意見をいただきました。

評価項目⑨：（評価項目①～⑤）の改善状況でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、知財関連団体及び代理人との品質ポリシーに関する意見交換や、特許審査部版バリューズに関する各審査室でのディスカッションの結果等も踏まえ、品質ポリシー等についてのレビューを実施している点、新型コロナウイルス感染症の影響下において、テレワークを可能とする手続、基準、組織の調整によって審査の停滞を回避したなど、審査実施体制の改善がされている点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、品質ポリシーは時代とともに変化していくべきものと考えられるので、今後ともレビューを続けて、しかるべき時期の改訂へとつなげていただきたい点、審査へのAI技術の活用などを検討し、効率的な審査実施体制を模索されたい点などの御意見をいただきました。

評価項目⑩：（評価項目⑥～⑧）の改善状況でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点として、テレワーク環境下で審査における判断の均質性への懸念が増加したなどの声はあがっておらず、適切な改善が進められている点などの御意見をいただきました。

今後期待される点として、面接の拡充については審査の質向上のための長期的な課題として積極的に取り組んでいただきたい点、審査の質の分析・課題抽出を抽象的レベルにとどめることなく、具体的な改善策を示してほしい点などの御意見をいただきました。

評価項目⑪：審査の質向上に関する取組の情報発信でございます。中央値は「良好」でした。

評価された点は、国内での企業コンタクトやASEAN関連の研修、ソフトウェア関連発明に関する比較研究をEPOと行うなどの国際的な活動に力が入っている点、スタートアップ向けサイトも充実し、初心者にもわかりやすい情報発信をされている点などの御意見をいただきました。

今後期待される点は、国際会合等における情報発信は、世界最高水準の特許審査を目指す上で重要であり、今後とも積極的に取り組まれたいとの御意見をいただきました。

特許は以上となります。次は、意匠の説明をさせていただきます。

○下村意匠課長 意匠課長の下村でございます。私からは、意匠に関する評価結果の概要を御説明申し上げます。特許審査と同様に、委員の皆様から「極めて良好」と御評価をいただきました①～③の項目につきましては割愛させていただきます。

では、まず資料３の 11 ページ中ほどの評価項目④の審査実施体制でございます。こちらの御評価の中央値は「概ね達成」でございました。

評価いただきました点としましては、法改正による新分野の審査、関連する審査基準の改訂に加えまして、国際出願の増加や感染症拡大の影響がある中での審査遅延の防止といった取組結果を挙げていただきました。

今後期待される点としましては、審査官一人当たりの審査件数が米国と比較して多い現状にありますけれども、他国に比して審査体制、人員配置が確立しているとまでは言えない状況との御意見。それから、令和元年意匠法改正による保護対象の拡大に十分対応できているか否かの注視が必要といった御意見などをいただきました。

続きまして、12 ページ中ほどの評価項目⑤の品質管理体制でございます。こちらの中央値は「良好」でございました。

御評価いただきました点としましては、国際的に遜色のない水準において、品質管理の取組が実施可能となる組織体系を確立している点などを挙げていただきました。

今後期待される点としましては、品質監査結果のフィードバックを受けた各審査長単位におきまして、審査官の指導が適切に行われることを期待するといった御意見などをいただきました。

続きまして 13 ページ、評価項目⑥の品質向上のための取組でございます。こちらの中央値は「良好」でした。

御評価いただきました点としましては、意匠法改正に関連する新たな出願の審査や、国際出願の審査につきまして、協議を行う取組がなされていることなどを挙げていただきました。

今後期待される点としましては、オンライン面接や電話対応について、さらなる改善、拡充が期待されるといった御指摘などをいただきました。

続きまして、13 ページ下方の評価項目⑦の品質検証のための取組でございますが、こちらの中央値は「良好」でした。

御評価いただきました点としましては、無作為抽出による品質監査やユーザー評価調査・ユーザーとの意見交換による現状把握など、品質検証のための取組が計画的に実施されて

いること。また、昨年度のユーザー評価調査の分析結果を受けまして、重点的に取り組んだ項目について、今年度の評価は向上しておりまして、検証結果を品質向上につなげる着実な取組がなされているといった点などを挙げていただきました。

今後期待される点としましては、国内の大企業のみならず、海外企業等との意見交換も継続、拡充することを期待するといった御意見などをいただきました。

続きまして、資料 14 ページ中ほどの評価項目⑧の審査の質の分析・課題抽出でございますが、御評価の中央値は「良好」でした。

評価いただいた点としましては、品質監査やユーザー調査評価、審判決との判断相違の要因分析などを通じて得られました気づきを集約して、審査の質の分析と課題抽出が適切に行われている。前年度抽出された課題について今年度重点的に品質監査を行うなど、課題解決に向けた着実な取組がなされているとの御意見などをいただきました。

今後期待される点としましては、抽出された課題が拒絶理由通知の記載の仕方等の形式的な点であることが気になりますものの、国際出願の審査の詳細な分析などにも取り組んでいくということなので、今後実態的な課題が抽出されていくかどうかを注視していきたいといった御意見などをいただきました。

続きまして 15 ページ、評価項目⑨の（評価項目①～⑤）の改善状況及び、まとめて次の項目となりますが、資料 16 ページ中ほどの評価項目⑩の（評価項目⑥～⑧）の改善状況でございますが、いずれも御評価の中央値は「良好」でした。

⑨と⑩の両項目につきましては、評価項目⑧までの内容とほぼ共通したものでございますので、御説明を割愛させていただきます。

続きまして、資料 16 ページ下方の評価項目⑪の審査の質の向上に関する取組の情報発信でございますが、こちらの中央値は「良好」でした。

御評価いただいた点としましては、審査の品質向上に関する情報発信を国内ユーザーに対して行い、かつ、定期的に意見交換を実施するなど、継続的な協力関係を構築している。また、各種セミナーを通じて、海外ユーザーからの情報収集や情報発信を継続的に実施している点は評価されるといった御意見などをいただきました。

今後期待される点としましては、ユーザーへの情報発信について情報を整理し、アクセシビリティを向上させるような対応を期待する。また、多くのユーザーが参加できるように、意匠法改正や意匠審査基準改訂の説明会は、今後も引き続きオンラインでの実施が望ましいといった御意見などをいただきました。

意匠につきましては以上となります。

○高野商標課長 おはようございます。商標課長の高野でございます。聞こえますでしょうか。

○船越品質管理室長 聞こえております。お願いします。

○高野商標課長 続きまして、商標の評価について御説明申し上げます。評価項目①～③については「極めて良好」と評価いただいておりますので、説明を割愛させていただきます。

評価項目④でございますが、全委員から「概ね達成」と評価いただきました。

評価いただいた点といたしましては、出願件数の急増に対応して任期付審査官の採用、指導体制の見直し、審査官補向け研修の充実化、効率的な人員配置など、各種対策を講じた点について評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、審査期間の長期化のなお一層の改善、審査官の絶対数が少なく、審査官1人当たりの審査処理負担が大きいことから、審査体制・人員配置に課題があるとの御意見をいただいております。

続きまして、評価項目⑤でございます。全委員から「良好」と評価いただきました。

評価された点につきましては特許と同様ですので割愛させていただきます。

今後期待される点といたしましては、審査官間の均質性が課題であることから、審査品質管理体制の適切な運用と効果の確認を期待するとの御意見をいただきました。

続きまして、評価項目⑥でございます。全委員から「良好」と評価いただきました。

評価いただいた点といたしましては、重要性に応じてメリハリをつけた案件協議の実施、AI技術を用いた審査効率化の取組が進められていることについて評価いただきました。また、電子メールでの補正案送付、オンライン面接に利用可能なWeb会議サービスの拡充、テレワークシステム及び審査支援ツールの改良、運用保守を行うことにより、業務の効率化を図っている点について評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、オンライン上のコミュニケーションを含むユーザーとのコミュニケーションの充実に係る取組について、ウイズコロナ・ポストコロナの時代を見据えた手続のオンライン化・合理化などの御意見をいただきました。

続きまして、評価項目⑦でございます。全委員から「良好」と評価いただきました。

評価いただいた点といたしましては、ユーザー評価調査の実施、及び分析が継続して行われている点について評価いただきました。意見交換会を通じた審査の質の現状やニーズ

を把握、分析している点についても評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、ユーザー評価調査で重点項目とされた項目に限らず、その他の項目についても引き続き質の維持・向上のための取組を推進することと、ユーザーからのコメントを踏まえて、どのような改善策がとられたかを公表することを検討されたいとの御意見をいただきました。また、ユーザーから審査処理期間の長期化の問題解決と審査官間の均質性を求める声があるため、品質検証の結果を審査品質向上に反映していくことを期待するとの御意見をいただいております。

続きまして、評価項目⑧でございます。中央値は「良好」と評価いただきました。「概ね達成」との評価もいただいております。

評価いただいた点といたしましては、審査の質の維持の向上をすべく、審査部門内で情報共有を図り、共通認識を高める取組をしている点について評価いただきました。手続の段階ごとに分析と課題抽出が適切に行われている点についても評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、各種取組において審査の質の分析と課題抽出を行った結果に基づく、さらなる審査品質向上が期待されるなどの御意見をいただきました。

続きまして、評価項目⑨でございます。中央値として「良好」と評価いただきました。他方、「極めて良好」との評価も多くございました。

評価いただいた点といたしましては、任期付審査官の採用、オンライン対応の改善、審査効率化プロジェクトの継続による審査期間長期化傾向の改善について評価いただきました。また、審査実施体制強化により、審査処理件数が増加した点についても評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、引き続き先行図形商標調査におけるA Iの活用や民間調査者の活用等の調査を積極的に進められたいとの御意見をいただきました。また、引き続きユーザーの出願支援と審査効率化に資する取組の実施を期待するなどの御意見をいただきました。

続いて、評価項目⑩でございます。全委員から「良好」と評価いただきました。評価いただいた点といたしましては、テレワークシステム及び審査支援ツールの改良、データの運用保守を行うことにより業務の効率化を図り、業務環境の変化に対応した品質管理の取組の改善を行った点について評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、ファストトラック該当案件の判定ツールや、応対記録の電子化等の審査支援ツールの積極的な活用を進められたいとの御意見をいただきま

した。また、ユーザーからの否定的なコメントを踏まえて、どのような改善策がとられたか、代表的な部分について公表することを検討されたいとの御意見をいただきました。また、テレワーク中の審査官との連絡手段の整備、改善を期待するとの御意見をいただきました。

続いて、評価項目⑪でございます。中央値は「良好」と評価いただきました。他方「極めて良好」との評価もいただきました。

評価された点といたしましては、新興国特許庁職員に対し日本の特許庁の品質管理システムを紹介するなど、新興国の特許庁の審査の品質の向上に貢献している点について評価いただきました。

今後期待される点といたしましては、新興国の知財庁の職員の受け入れ研修の積極的な推進が望まれるとの御意見をいただきました。また、国内での情報発信と海外への情報発信の意味合いの相違に即応した取組の実施が望まれるとの御意見をいただきました。

以上でございます。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

それでは、今、御報告いただきました本小委員会の評価結果につきまして、御意見がある方は挙手または御発言希望の旨をチャット欄に御記入ください。いかがでございましょうか。

それでは本多委員、よろしくお願いいたします。

○本多委員 委員の本多でございます。本日は御説明いただき、ありがとうございます。

まず、審査の質の向上の項目は、毎年「概ね達成」という評価になっているかと思えます。こちらは御庁だけのことで、いかんともしがたい点もあるかと思いますが、任期付審査官や民間調査機関の利用など大変工夫されている点、評価させていただきたいと思えます。

ただ、やはり意匠につきましては保護対象の拡充があり、商標につきましては商標出願件数の増大ということがございます。どうしても限られた人員では、できることが限られてしまっていると思います。ぜひ、この点は積極的に何とか人員を増やしていただいて、審査の充実及び促進に期していただきたいと、強く願っております。すぐには改善できないことと存じておりますが、日本の知財を世界に広めていくためには、人員の確保は必須と感じておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。

また、面接審査につきまして、テレワークが幸いいたしまして電話での対応をしていた

だけるということ。こちらは海外の知財の団体等からも大変興味を持って、複数問い合わせをいただいております。実は先週もオーストラリアの知財団体に対して、日本の特許制度について説明する機会をいただきました。その際も電話でのインタビューができるということに、大変興味を抱いていただきました。

この点も条件その他ホームページなどで発信させていただいていると理解しております。併せて、御対応される担当審査官の方々にも情報共有を徹底していただき、一律の御対応で電話のインタビューなどをお受けいただけるようお願いいたします。

商標につきましては、F Aの目標が少しずつ達成されていると御説明いただきました。審査においては今までも、例えば商品の補正案について、大変親切に案を審査官が提案してくださるなど、ユーザーフレンドリーな対応をしていただいております。審査促進を図りながらも、ぜひ、そういった親切な御対応はそのまま維持していただきながら、何とか御努力いただければと願っております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。本多委員から御意見いただきました。人員については商標と意匠について挙げていただきましたが、恐らく特許でも拡充ができれば望ましいというところはあろうかと考えております。ありがとうございます。

ほかに何かございますでしょうか。

それでは近藤委員からも御意見いただけるということでございますので、よろしくお願いいたします。

○近藤委員 ありがとうございます。聞こえますでしょうか。

○井上（由）委員長 聞こえております。

○近藤委員 今回おまとめいただいた評価結果につきましては、内容については異論ございません。その上で、本日は私がいたしました評価に関して、特許、意匠、商標について、ポイントとなるところだけコメントさせていただきたいと思います。

まず特許ですけれども、監査結果やアンケート結果を見ますと、いまだ目に見えるほどの改善効果が出ているとは言いがたいので、項目⑩については「概ね達成」を維持いたしました。

一方、項目⑦につきましては、コロナ禍で昨年はうまくいかなかった企業コンタクト数も本年は増加してきております。さらに加えて個別の意見の聴取と、その結果の審査官へのフィードバックなども行われてきておりますので、昨年下げた評価を今回アップいたし

ました。

また、項目⑨についても、コロナ禍でリモートワークの活用など多くの改善が認められておりますので、評価をアップいたしました。

次に意匠ですが、アンケート結果を見ますと満足度についてはおおむねよくなっているのですが、比較的不満の意見が増加しているところが少し気になります。個別の評価結果に関して申し上げますと、改正意匠法関係の啓発や審査官の教育などを行ったり、テレワーク対応やオンライン面接の支援拡充などの対応をされていることは理解しつつも、既に多くの項目は「良好」として評価しておりますので、「極めて良好」とするレベルにはまだ至っていないと評価し、昨年の評価を維持しております。

最後に商標ですが、任期付審査官などの採用を含めた人員の増強、そして審査官補の数に合わせた指導体制の見直しなどを実施して審査処理件数を大幅に増加させ、審査処理期間の長期化も確実に改善されていることを考慮して、項目⑨については評価をアップいたしました。

ただし、審査体制の絶対的レベルの評価である項目④については、まだまだだなと判断して評価を維持しております。

以上でございます。

○井上（由）委員長 近藤委員、ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

それではありがとうございました。本小委員会の評価結果につきましては、事務局案のとおりとさせていただきます。ありがとうございます。

議題２ 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について

○井上（由）委員長 では、次の議題に移ります。次の議題は「審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について」でございます。

こちらは資料４でございますが、事務局から説明をお願いいたします。

○船越品質管理室長 資料４は、各委員からいただきました改善提案を評価項目ごとにまとめさせていただいたものです。本小委員会としての改善提言につきましては、本日の御審議を踏まえ、事務局にて整理させていただきたいと存じます。

○井上（由）委員長 本日、委員の皆様は御自身の改善提案についてお伺いしたいと存じます。よろしければ、井上委員から委員名簿順にということをお願いいたします。

井上委員、よろしくお願いいたします。

○井上（渉）委員 井上でございます。ありがとうございます。

全体的に申し上げまして、昨年度に続くコロナ禍においてオンライン面接の拡充など、ユーザーとのコミュニケーションは着実に回復と考えております。

人員体制のことについては、特許庁の問題というよりは政府全体の問題で課題だと思いますし、望まれる水準には達してはいないものの、限られた人員、またテレワークの定着といった従来と異なる環境におきまして、特許、意匠、商標全てにおいてITを上手に活用しながら質的向上を果たしていると思っております。この点は高く評価してよいのではないかと思います。

強いて課題を挙げさせていただくとすれば、均質性の問題かなと思います。特許庁の審査の質は世界的に見ても非常にレベルが高いと認識しておりますけれども、ユーザー評価調査を見ても、「均質性に不満」と回答する向きが一定数存在しているのも事実でございます。こうした不満を直接吸い上げるような仕組みをさらに強化していただいて、品質改善につなげてほしいと思っています。

以上でございます。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

それでは次に大須賀委員、よろしくお願いいたします。

○大須賀委員 委員の大須賀でございます。項目ごとに分けてお話しさせていただきたいと思います。まず特許の関係では、今年、特に提案したわけではないのですが、昨年、品質管理ポリシーと品質マニュアルの関係を指摘した関係で、若干補足的にお話しさせていただきたいと思います。

今回、特許庁で作成されておりますミッション・ビジョン・バリューズ、先ほどもバリューズというのが少し出ておりましたけれども、それを拝見させていただきました。それを見ましたところ、私が考えているイメージとしての品質ポリシーに該当するのが、そのうちのミッション・ビジョンに相当するもので、バリューズのものが品質マニュアルに相当するものだという理解ができるのではないかと拝見いたしました。

そういうふうに考えるのは、品質ポリシーというのは組織全体としての目標を明確にする、それに向かって職員の皆さんが励んでいくといえますか、そういう指針を明確に示していくことが重要な役割であり、他方、そのための施策をマニュアルに書き込んでいくという役割分担ができるのではないかという理由からです。

今現在のポリシーは、目標と施策の部分がやや渾然一体としているところがあって、目標をきちっとしたものとして把握しづらい部分があるのではないかと考えておりますので、たまたまミッション・ビジョン・バリューズを拝見したところ、そういう感じが出ていると考えましたので、ここで補足をさせていただきたいと思います。

それから、特許の関係でもう1点はオンライン面接の関係ですが、オンライン面接自体がコロナ時代ということでやむにやまれずといえますか、必要として始まったものだと思いますが、長期的に見てユーザーとの意見交換をきちんとするということが、審査の質を向上させていくという意味で非常に重要だと思っております。その点から言いますと、オンライン面接というのはユーザー側にとっては、わざわざ特許庁まで出向かなくても対応できるという点で非常に利便性が高い、その結果として、ユーザーの方の面接への希望も増えるというふうに理解できますので、そういった方法を長期的に見ても、より活用していただいて、審査の質の向上につなげていただきたいと思いますと考えております。

それから意匠の関係では、建築物あるいは内装の意匠についても順調に出願されているようですので、恐らくブランド価値の向上という社会の意識、あるいは企業の意識が反映されていて、順調に進んでいるのではないかなと理解しております。

ただ、内装の意匠に関しましては建築物と違って今までにない制度なので、少し資料の収集が足りていないところがあるのではないかと思います。その結果として、そういうことはないかもしれませんが、適切でない登録がされたりいたしますと、出願意欲という面から見ても、必ずしもいい影響を与えないのではないかと考えておりますので先行文献、あるいは先行資料の収集は、企業あるいはほかの団体からの協力も得られるかと思っておりますので、積極的に努めていただきたいと思いますと考えております。

最後に商標の関係ですが、従来から審査官の間での判断のばらつきということ、あるいは識別性の判断ということが、継続的に指摘されております。この点はなかなか課題の抽出は難しいとは思いますが、なぜそういうことが起きてくるのか、毎年同じように指摘されてくるのかを、もう少し細かく分析、あるいは調査していただいて、具体的な改善策、こうすれば改善するというところの指針を、明確に得られるような検討をしていただければと思っております。

私からは以上です。

○井上（由）委員長 大須賀委員、ありがとうございました。

次に近藤委員、お願いいたします。

○近藤委員 聞こえますでしょうか。

○井上（由）委員長 はい、聞こえております。

○近藤委員 回線の状況があまりよくないようなので、カメラはオフさせていただきます。

○井上（由）委員長 よろしく申し上げます。

○近藤委員 改善提案をおまとめいただいたところについては内容に異論はございませんので、特に申し上げたいことを、特許、意匠、商標についてポイントのみ、コメントさせていただきます。

まず特許ですが、アンケート結果は全体評価が頭打ちになっているのではないかなと見えますし、今年は不満意見が増えているところが気になります。また、均質性について悪化していることも気になるところです。そこで、これまでの施策で本当によいのかどうかという振り返りも含めて、新たな対策の可否も検討されることを期待したいと思います。

それから意匠ですけれども、先ほど申し上げたようにアンケート結果はおおむねよくなっていると思いますが、比較的不満意見が増加しているのが気になります。項目別では均質性の否定意見が減少しないということや、国際意匠登録出願の審査全般の質に関して満足度が相対的に低いことが課題だと思われます。そこで、国際意匠登録出願の審査に対応した研修等の取組の充実が望まれますし、審査の均質性では出願が急に増えた分野や、法改正によって新たな分野が出てきたところにおいても、この均質性が担保されるように、新たな取組の必要性も含めて対応を検討いただきたいと思います。

最後に商標ですけれども、重点課題とされている審査官間の均質性、識別性の判断については昨年より悪化しているということですので、それらに関するユーザーの問題意識やニーズをヒアリングして、さらなる有効な対策の検討を期待いたします。

また最後に、審査官の数の増員があつたとしても、審査の品質の維持や均質性の維持も確保いただけるよう対策を期待いたします。

以上です。

○井上（由）委員長 近藤委員、ありがとうございました。

次に菅原委員、お願いいたします。

○菅原委員 ありがとうございます。菅原です。それでは私から、改善提言について説明させていただきます。

まず、特許の項目④についてですが、商標で挙げていただいた取組で、審査業務効率化検討プロジェクトがありました。そこでは拒絶理由通知書の問い合わせ欄に、特許庁ホー

ホームページのお助けサイトなどの案内が記載されているという取組があったかと思います。このような取組がうまくいっているということであれば、特許の審査や意匠の審査にも、ぜひ実効的な形で採用することを提案したいと思います。

同様の施策をすることも考えられますが、例えば品質管理の向上という意味であれば、一案にすぎないですが、特許査定にユーザーアンケートページのリンクをつけるなどして自動集計するなどといった、ユーザー調査のD X化につながるような取組も考えていっていいのではないかと考えております。

現在の特許庁ホームページの品質管理室の連絡欄があるのですが、ともすると苦情受付の役割になっておりまして、ユーザーからの肯定的なよい声、よい評価が届きにくいのではないかなというのが気になっているので、D X化とあわせて検討いただけるといいかなと思っています。

次に2番目、村松委員が今日欠席ということなので1つ上の項目も説明させていただきますが、先端技術や、特にA I ・ I o T関連発明について、審査の質の維持・向上に取り組むことに期待するということでして、特にA I ・ I o T担当審査官が設けられております。これはよい取組だと考えておりまして、日本弁理士会の特許委員会の中でも好評でございます。特に、被協議者が実際にサーチを行って、その結果を踏まえて担当審査官にアドバイスを行うという方式が、形式的な助言にとどまらない、深入りした協議になっている点でよいかなと考えております。

もし、ほかの先端技術分野や、ユーザーの特定の技術分野について苦情といいますか、少し審査の質のばらつきが多いなどがあった場合は、ほかの技術分野にもこういう専門審査官という制度を設けていただいて、ほかの審査官と協議できるなどの体制をとっていただくと、審査の均質化につながるのではないかと考えております。

次に、特許の中では項目の⑪のところだったかと思うのですが、去年一気に電子メールの活用が進んでいることを、かなり評価しております。そこで、弁理士実務をやっている特許事務所の中では、電子メールのアドレスがいつわかるのかという情報発信が、少し足りていないのではないかという意見がございました。

例えば、拒絶理由通知書には昔F A X番号が書いてあったのですが、今はメールアドレスは書かれていないということになっています。そこは書かれていなくてもいいという意見も多いのですが、例えば電話で審査官に連絡をとったときにメールアドレスを教えてもらうですとか、直接連絡ができないときにすぐに連絡ができるようにメールアドレスを教

えてもらえるような運用としていただけると、コミュニケーションのとりやすさがよりよくなって、よいかなと思っています。

それからその下の項目で、テレワーク中の審査官との面接・電話対応についての手順の明確化ですが、特に未公開案件について、現在事務連絡だけはしていいということにはなっているかと思いますが、これが未公開案件であるからということなのかどうかというのがわかっていないということで、少し混乱が起きている印象がございます。特許事務所で実際に審査官の方に連絡をとっている弁理士の声からすると、ある案件では審査官がテレワークで審査をしてくれるのですが、別の案件——それは多分未公開案件だと思うのですが、その案件では登庁日まで待つてほしいと言われることがあって、審査官によって対応が異なるですとか、審査の均質性がそろっていないのではないかという意見が挙がっております。未公開案件については、審査官が外部でテレワークでは扱うことが今はできないのだということを積極的に情報発信していただくと、現場での混乱が少なくなっているのではないかなと考えております。

ちなみにですが、未公開案件についてテレワークで扱うべきという意見も一部にあったのですが、現在、秘密特許の制度が報道などで検討されていると伺っていますので、むしろ慎重にされたほうがよいかなと思います。未公開案件については、当面は現状どおりの体制で進めていくのがよいかなと考えております。

特許については以上でして、次に意匠について私のほうからは、評価項目の⑧審査の質の分析・課題抽出について一言述べさせていただきます。こちらは内外管理案件の分析を今後進めると伺っておりまして、これはよい取組だなと考えております。

こちらは特許で以前に分析を行いまして、その結果、例えばですが日本の特許査定率が高いという声があったと思うのですが、それに対して結果を分析していただいて、その結果をユーザーに共有いただいたことによって、ユーザーの納得感が高まったという経緯がございます。

国際意匠登録出願について、まだ意匠の登録率が高いか低いかですとか、それが日本のユーザーにとって有利か不利かという論点は、まだ抽出はできていないと思うのですが、今後そのような何らかの課題が抽出できて、今後の制度、審査の質の改善に役立っていくようになるというかなと考えておりますので、ぜひ、こちらを進めていただきたいと考えております。

商標については一言、情報発信の項目⑩について述べさせていただきたいと思います。

電子メールの活用というのは先ほどと同じなのですが、商標の場合ですと審査の区分どおりである場合に、ファストトラックとして審査着手するという制度があると思うのですが、そちらに起因してだと思いますが、同じ日に出願しても区分数に応じてですとか、2以上の出願が違う時期に査定が届くという声が挙がっていて、それが何でなんだろうという声が挙がってきています。それが多分、ファストトラックとして審査着手しているということだと思うのですが、その点などについて、まだユーザーに周知されていない印象があって、審査のばらつきじゃないのかと言われる声も挙がっていますので、その点、商標特有の情報についても積極的に情報発信していただきたいと思います。

私からは以上です。

○井上（由）委員長 菅原委員、ありがとうございました。

それでは別宮委員、お願いいたします。

○別宮委員 別宮でございます。それでは私から、改善提案の内容を簡単に御説明させていただきます。

まず特許ですけども、私からは項目⑥関連ということでコメントをさせていただきます。品質向上のための取組に関するところですが、コロナ禍ということもございますので、出願人とのコミュニケーションや相互理解を深めていただいて、納得感の高い結論が得られるように、オンライン面接の環境整備、利用促進をお願いしたいと思います。既に取り組まれていることは承知しておりますが、引き続きこれを推進していただければと思います。

それから、項目⑧関連でもコメントさせていただきました。審査の質の分析・課題抽出のところですけども、特許庁さんは世界最高水準の品質を目指されているということもございますので、こういうことを踏まえすと、数は少ないことは理解しているのですが、内外乖離、あるいは内々乖離が発生したときには要因分析、課題抽出を行って、特に内外乖離については海外特許庁への適切なフィードバック等、連携を推進していただきたい。それから内々乖離については、究極は発生ゼロを実現していただきたいと思っております。JPOの審査品質は世界一ということであれば、JPOがお墨付きを出した特許は全世界で通用するといったところを、ぜひ目指していただきたいと思います。

続いて、意匠に移りたいと思います。ほかの委員からも改善提案が出ていたと思いますが、項目②、③、④関連です。改正意匠法、施行規則、審査基準、それぞれ確かに改訂されておりますので、手続の明確性、公表と周知、審査実施体制の維持・向上を引き続き、

ぜひ推進いただきたいと思います。なかなかどこまで審査が認められるだろうかというのは難しいところもございますので、ぜひ、事例等を混せて理解できるように取り組んでいただきたいと思います。

項目⑥関連は特許と同じですが、やはり出願人とのコミュニケーションを引き続き改善、推進していただきたいと思っております。

商標のほうにいきまして、これも重複ですね。特許、意匠と同じですが、コロナ禍でも出願人とのコミュニケーション、相互理解を深めて、納得感が高い結論が得られるようにしていただきたいと思っております。

以上、簡単でございますが私からの改善提案の内容です。よろしくお願いいたします。
○井上（由）委員長 ありがとうございます。

では次に本多委員、よろしくお願いいたします。

○本多委員 本多でございます。先ほど述べさせていただきましたものと重複する点は割愛させていただきたいと思います。

まず特許に関しまして、井上委員長より御指摘いただきましたように、審査官の増員につきまして、日々革新していく技術に追いつくためにも、審査官の増強は必要ではないかと思えます。

また、品質監査の点でも、特許庁様の品質監査は他の知財庁と比べましても非常にしっかりしているものと認識しております。例えば、USPTO、EPOの方からも、品質監査については非常に力を入れていると説明をいただくこともございます。このような説明を伺いまして、日本の特許庁の品質管理は大変すぐれたものと感じます。そういった管理も維持するために、経験豊富な審査官に限られた人員から割いていらっしゃるなどの御説明いただきながら感じておりますので、この面からもぜひ、人員の増強は積極的に行っていただきたいと思っております。

また、特許の判断の均質性につきましては、技術分野ごとに違っているのではないかという声もあるようですので、この点も踏まえて判断の均質性に今後も臨んでいただければと思っております。

意匠につきましては、先ほども申しましたように保護対象を拡充されました。審査基準なども保護対象の拡充を見越して作成されているということで、大変詳しく基準ができていると思っております。ただ、実際に審査を行っていく段階で、実態に即さない点も出てくるのではないかと思います。ぜひ、引き続き見直しをしながらの保護対象拡充への御対

応をお願いしたいと思っております。

商標につきましても同様でございます。非伝統的商標が入りまして大分たちました。これまでの判決を受けて、審査基準も見直していただいているようでございます。ただ、判決を受けてというだけではなく、やはり実態に即さない審査になっている点なども検証いただき、随時審査基準などを見直していただきたいと思いますと思っております。

また、審査官研修の充実はもちろんのこと、研修の結果の検証などもしていただきたいと御提案させていただいております。審査官に直接御連絡させていただいて、その審査官との御判断が審査官により異なることがありますと、出願人が対応に苦慮することもございますので、ぜひ、研修の充実とフィードバックを続けていただきたいと思いますと思っております。

以上でございます。ありがとうございます。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

それでは私からも補充的に、私の改善提案について御説明したいと思います。特許、意匠、商標、分けてということではなくて御説明いたしたいと思っております。

まず、先ほど本多委員等からも出ましたし私も申し上げましたが、人員、審査官の数の充実ということでございます。特許庁の財政状況を考えますと、なかなか簡単にはいかないことは承知しておりますけれども、特許庁の行政における品質管理という観点からだけでなく、グローバルスタンダードで高い品質の審査ができる人材を増やしていくということは、日本の国にとっても非常に重要なことであろうと思っております。

コーポレートガバナンスコードの改訂によりまして、知財に関する情報の開示が求められるようになっておりますが、特許、意匠、商標の審査が的確にできる人材というのは、知財価値の評価の基礎となる情報を提供できる人材となりますので、官民間問わず、そういった人材を強化していくことが求められていると思います。その意味では、特許庁は行政の枠を越えて人材を拡充する必要があることを、強く財務省などにも主張していただければいいのではないかと考えております。

加えまして審査官の数、人を増やすということだけではなくて、審査のDX化も進めていただきたいと思います。こちら商標を中心にPDCAを回しながら、新しい仕組みをいろいろ取り入れておられると伺っておりますが、こういった取組をさらに強化していただきたいと思いますと考えております。

それから改善提案のところに書かせていただきましたが、アメリカの品質管理の取組の

ところを見ておりますと、特にコミュニケーションの仕組みのところ、ユーザー側からのアンケートをとってコミュニケーションの質を評価するというだけでなく、審査官の側から自分たちのコミュニケーションの質を評価することもしているとホームページで見えます。両側から課題を抽出していくということもあり得るのかなと思いますので、特許庁の審査官の側の調査などもしていただいて——していただいているところはあるのだと思いますが、品質管理の中にも取り入れていただけたらよいのではないかと考えております。

そんなところでございます。ありがとうございます。

○船越品質管理室長 委員の皆様、貴重な御意見、まことにありがとうございます。いただきました御意見につきましては真摯に受けとめまして、今後の品質管理の取組を推進してまいりたいと思います。

いただいた御質問等につきまして、担当課のほうからお答えさせていただければと思います。まず私、品質管理室のほうからお答えさせていただければと思います。

判断の均質性も含めて、ユーザー評価調査の調査結果から見た今後の課題についての御意見をいただいたと思います。本年度は、不満と回答された方への聞き取りをさせていただきました。現在、その内容を分析しているところでございますので、こちらの分析結果を踏まえてしっかりと対応をしていきたいと考えてございます。

また、肯定的な声がなかなか届かないのではないかとといった御意見についても、御意見をいただけるような工夫等をしてまいりたいと思います。ありがとうございます。

また、品質マニュアル等について補足等御説明いただきましてありがとうございます。今般、レビューをさせていただきましたけれども、引き続き定期的にレビューをさせていただく予定でございますし、品質マニュアルについては改訂等の検討をさらに進めたいと思っておりますので、こちらも引き続き対応していきたいと思っております。

内外乖離、内々乖離についてありがとうございます。こちらは庁のほうでも分析しておりますが、本年度はユーザーの皆様とも意見交換をさせていただいて、現状何を感じているのか、どこに課題があるのかといった点も御意見をいただいたところでございます。こちらの御意見も踏まえまして、さらなる分析をしつつ、対応していきたいと思っております。

では、調整課長からお願いいたします。

○野仲調整課長 調整課・野仲でございます。本日は貴重な御意見を賜りまして、まこと

にありがとうございました。船越からの説明と重複する部分は避けますが、いろいろ御意見をいただいた中で、まず出願人の皆様とのコミュニケーションに関する御指摘がたくさんありました。今後もオンラインの環境となったこと、むしろこれを利用して、多くの皆様ときちんとコミュニケーションがとれるようにやっていきたいと思えます。

その中で、まずメールを活用するときに、連絡先のメールのアドレスがいつ開示されるかという御指摘がございました。本件、まさに今、検討を進めておりまして、来月早々にも新しい運用を開始したいと思っております。拒絶理由の中に直接的にメールアドレスを書いてしまうと、スパムメールなどの対象になってしまうというおそれがあるので、メールアドレス中のわかりにくい部分のみを拒絶理由の中に直接記載させていただいて、そこに必要な部分を追加してメールアドレスにしてもらう形です。

端的に言いますと、頭の部分が「PA 何とか」でトータル4文字、以下「@jpo.go.jp」となっていますが、@以下のところは書かずに、頭の部分について拒絶理由の中に記載をさせていただくということで、わかりやすくしていきたいと思っております。

また、運用についてもホームページの記載等をなるべくわかりやすくするとともに、庁内の審査官にも運用について徹底していきたいと思えます。

また、均質性に関する御指摘も多かったと思えます。こちらについては、頭打ちになっているというお話もいただいております。今回、この後の議題に出てきますけれども、10年間を振り返った分析をしているのは、我々の課題意識もそういうところにあるためです。どういうところがどこまで進んできて、何が頭打ちになっているのかというところはしっかり見直しをして、その中で重点を置くべきところは変わってきているのかなと思えますので、なるべく形式的なところで、既に対応が大きく進んだところは簡略化をしていく、自動化をしていく。その上で、より中身に関わる部分、均質性に関する部分等で改善ができるように、対応策についてもこれから見直しをしていきたいと思っております。

増員については毎年御指摘をいただいているところでありまして、我々としてもきちんと対応していきたいと思っておりますが、種々の制約があるところは委員の皆様からも御指摘があったとおりでございます。増員自体は当然努力を続けていきますが、それ以外に御指摘のあったDX化やAI技術の活用も含めて、同じ人数でも、より多くの仕事を、品質高くできる組織づくり、体制づくりも進めていきたいと思っております。

審査官の認識のアンケートの御指摘も大変興味深いところだと思っております。審査官がどのように認識しているかというところから、逆に掘り起こして課題も出てくるかもしれ

ませんので、そういうところもぜひ、対応させていただければと思います。

また、商標の取組を参考にしてはという御指摘もありました。法域ごとに違う要件もありますが、同じ審査ということで共通する部分も多数ございますので、ぜひ、そういうところは縦割りにならないようにして、横串でしっかりお互い情報共有をしてやっていきたいと思っております。本日は御指摘ありがとうございました。

○下村意匠課長 それでは、意匠分野に関する御質問、御指摘に対しましてお答えさせていただきます。

まずは、複数の委員の皆様から審査の体制を整備するように御指摘をいただきました。こちらは政府全体の定員削減の方針のもとで増員が厳しい状況ではございますが、十分な審査体制が維持できますように、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと思います。

また、井上委員長からも御示唆がありましたように、審査のD X化や審査ツールの活用などを行っていきまして、審査の効率性も上げていきたいと考えております。

それから大須賀委員から御指摘をいただきました、内装意匠の資料収集についてでございます。こちらは私どもも非常に審査資料の収集が困難な分野でございまして、課題と思っております。現状では建築団体の皆様と業界とのコミュニケーションを通じて、必要な資料についてのアドバイスをいただきながら、審査に有用な雑誌や図書の購入を進めてまいりまして、審査官が発見しました有用なインターネットサイトの情報を審査室内で共有するとともに、外部の委託事業者に資料収集を委託しているのですが、そちらに伝えてより有用なサイトから資料を抽出するための取組なども行っております。今後も引き続きユーザーの皆様と意見交換等をしながら、こうした資料収集の質を向上してまいりたいと考えております。

近藤委員から御指摘をいただきました、比較的不満の御意見が増加しているという点でございます。品管のユーザー調査結果を拝見するときに、上位評価の割合が向上しているか否かに注目してしまいがちですが、御指摘を踏まえまして、こういった不満との御意見を持つ皆様を少しでも減らすべく、取り組んでまいりたいと思います。

現状では今年度から、全員の皆様は難しいのですが、不満との御指摘のあった方のところに訪ねて行って、意見交換をしていく等の取組をしております。そういったところでいただいた御意見などを反映させながら、私どもの審査のあり方を随時顧みていきたいと思っております。

それから菅原委員から、内外乖離案件の分析を進めていく必要があるという御指摘をいただきました。国際出願の比較分析につきましては御指摘いただきましたように、私どもにとりましても非常に大きな気づきとなることが多いと考えております。意匠分野では取組をちょうど開始したばかりでございますが、鋭意取り組んでまいりまして、今後の私たちの審査の方向性を検討する上で役立てるとともに、ユーザーの皆様に必要な情報の発信をしてまいりたいと思います。

別宮委員、本多委員から改正意匠に基づく新保護領域の審査をしっかりとしていくこと、それからマニュアルの整備や周知をしっかりと適時の改訂を行うことという御指摘をいただきました。新しい保護対象の分野につきましては、今年の1月に審査の事例集をリリースさせていただきました。一部の優良な登録例を皆様にお知らせすることで図面の書き方ですとか、こういった分野の出願ができるんだということを、お知らせできているかなと思います。こちらの事例集は皆様からの御指摘を踏まえまして、今後も鋭意拡充してまいりたいと考えております。

それから出願人とのコミュニケーションにつきましては、コロナ禍で対面での面接等が非常に難しい状況となりましたが、意匠の分野は、お客様と一緒に図面を見ながら御相談しなくてはいけないということがありまして、非常にここが大きな課題と思っております。

従来は、FAXでしか補正案等を見せていただくことができない状況でございましたけれども、今般、FAXのみならずメール等でも補正案をお送りいただくことができるような環境整備をいたしましたので、ユーザーの皆様と図面を見ながら、例えばお電話、あるいはオンラインツール等でコミュニケーションがとれるようにしてまいりますので、引き続き充実したコミュニケーションをとっていただければと考えております。

私からは以上となります。

○高野商標課長 商標課長の高野でございます。商標についても貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。いただいた御意見について、私のほうから御説明させていただきます。

まず、多くの委員の方々から、審査官間の審査の均質性、特に識別力の判断にばらつきがあるのではないかと御意見をいただきました。我々も公平かつ一貫性のある審査結果を提供すべく運用を徹底するとともに、管理職による決裁や、審査官同士の協議等を着実に実施し審査官間の情報共有を図るなど、適切な審査の確保に努めているところでござ

います。

日々努力しているところですが、まだまだ不十分なところもあると認識いたしました。引き続き、ヒアリングなどを通じてユーザーの皆様から御意見を賜りながら、有効な手段について検討してまいりたいと思います。ユーザーの皆様にな得感のある審査ができるように、引き続き努力してまいりたいと考えております。引き続き御意見、アドバイスなどいただければと思います。

2点目として菅原委員から、同日に商標出願をしても審査着手時期が違うのではないかという御意見をいただきました。指定商品、役務の記載によって、ファストトラックの対象となる出願と、対象とならない出願がございます。ファストトラックの対象か否かによって、審査着手時期が異なるということが一つ考えられます。

もう一つとして、商標の審査室は指定商品・役務の産業別に幾つかございまして、出願された区分によって審査する審査室が異なります。審査室によって、出願から審査着手までの期間が異なっています。この審査室による審査の着手日の相違については均一になるよう、人員の配置を工夫するなど取り組んでいるところですが、どうしても差が出てしまいます。この審査室ごとの審査の着手日については特許庁のホームページにも掲載し、周知しているところではございますが、ユーザーの皆様にもっと浸透するように努力してまいりたいと考えております。

それから本多委員から、審査基準、判決等を踏まえて見直してはいるけれども、実態に即していない審査基準になっていないか、という御指摘をいただきました。引き続きユーザーニーズ等を踏まえ審査基準の見直しを行ってまいりたいと考えてございます。

商標の出願は年々が増えているところでございます。人員につきましても、来年度も含めて3年度続けて任期付審査官を採用し、審査処理に取り組んでまいりたいと考えてございます。ただ、どうしても人員が不足しているところは否めないところでございまして、限られた人員ではありますが、審査のサービス、審査の質は低下させずに、より一層審査の効率化、処理促進に取り組んでまいりたいと考えてございます。引き続き委員の皆様には、様々な御意見、アドバイスをいただければと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

○井上（由）委員長 ありがとうございました。

ただいま事務局から御説明いただきました。さらに御意見がある方は挙手、または御発言希望の旨をチャット欄に記入してください。

本多委員、お願いいたします。

○本多委員 質問させていただきます。先ほど野仲調整課長様より、拒絶理由にメールアドレスを一部と伺いました。大変便利になると思って期待しております。こちらの対応につきましては、意匠、商標についても同様と考えてよろしいのでしょうか。その点、確認させていただきたいと思います。

○下村意匠課長 意匠課の下村でございます。お答えさせていただきます。

意匠のほうは未公開案件を扱っており、また、意匠案件の性質上、一目図面を見られただけで出願内容の情報が流出してしまうという性質を持っておりますので、ユーザーの皆様からメールをお送りいただくときに、安全の確保から、一部の者しかアクセスできないメールアドレスにお送りいただくこと、さらには、不用意に補正案のメールを開くことがないように管理を行っていくことが必要となります。ですので、こうした運用を行っていく上で、ユーザーの皆様から事前に御連絡なくメールが来てしまいますと管理ができないものですから、まずはメールアドレスを記載せずに、審査官の電話番号を書いております。そして、お電話で御一報いただいた後にメールを送っていただく運用とさせていただいております。

○高野商標課長 商標課長の高野でございます。

商標については、既に拒絶理由の中にメールアドレスを記載しており、電子メールで補正案等を受け付けていると認識しております。

以上でございます。

○本多委員 ありがとうございます。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。

それでは、各委員からいただきました改善提案につきましては、今年度残りの審査品質管理、あるいは来年度の計画策定に生かしてまいりたいと思います。ありがとうございます。

議題3 ユーザー評価調査結果から見た審査関連施策について

○井上（由）委員長 では、次の議題でございます。「ユーザー評価調査結果から見た審査関連施策について」ということで資料5を用意しております。事務局から説明をお願いいたします。

○船越品質管理室長 資料5は、ユーザー評価調査の評価の推移とこれまでの審査関連施策を整理させていただいたものです。ユーザー評価調査は意匠、商標に先駆けて特許が先行的に実施をし、今年度で10回目を迎えました。例年、当小委員会では議題1と2にありますように、各年度の取組について御評価、御提案をいただいております。今年度はユーザー評価調査が特許で10回目ということもあり、これまでの評価の推移も御紹介させていただきたいと思います。

スライド1は、ユーザー評価調査の調査結果報告書の抜粋です。毎年ユーザーの皆様にご協力いただき、5段階評価でお答えをいただき、その調査結果を特許庁ホームページで公開しております。

スライド2は、審査部における特許の質の維持・向上のためのサイクルを示しております。審査部全体でPDCAサイクルを回しつつ、審査庁単位でもPDCAサイクルを回すという2段階のPDCAサイクルとなっております。

スライド3は、特許庁の品質管理システムの全体像を示しており、当小委員会との関係性も示しております。

スライド4は、特許審査業務の概要です。審査官はサーチをして判断をして起案をして、またその過程においてユーザーの方々と面接や電話をさせていただきます。この一連のプロセスを、このスライドで示しております。そして、ユーザー評価調査ではこれらプロセス全体、つまり特許審査全般の質についてのアンケートを実施するとともに、各審査のプロセスに関してもアンケートを実施しております。

スライド5以降では、ユーザー評価調査の5段階評価における上位評価の推移と、それに関連した施策をまとめております。スライド5は、特許審査全般の質の上位評価の割合の推移と、それに関連した施策を簡潔にまとめております。スライド中の図形において、その図形が四角形、右端が直線になっているものはその年に施策が講じられたことを指名しており、また、その図形の右端が三角形状となっているものは、現在も継続して取り組んでいることを示しております。

スライド6は、サーチにおける上位評価割合の推移を示しております。特許では国内特許文献、外国特許文献、非特許文献、それぞれについてアンケートを実施しておりますので、それぞれの文献に対する推移を示しております。また、こちらのスライドでは併せて、スライド下方に外注案件数を言語種別ごとにお示ししております。

スライド7は、判断の均質性に関する上位評価の割合の推移を示しております。

スライド8は、起案についてということで、拒絶理由通知書、拒絶査定のわかりやすさ

に関する上位評価の割合の推移を示しております。

スライド 9 は、面接、電話等における審査官とのコミュニケーションに関する上位評価の割合の推移を示しております。

スライド 10 は、これまでの各評価項目の推移を 1 枚のスライドで御覧いただけるようにしたものです。折れ線は 3 つございます。緑色の折れ線は 5 段階評価のうち 3 以上の評価、つまり普通以上の評価の推移をあらわしております。現在、いずれの項目も普通以上の評価の割合は 80%以上となっており、また、普通以上の評価の割合が 90%以上の項目もあります。

青色の折れ線グラフはこれまでの説明と同様に、5 段階評価のうち 4 以上の評価、つまり上位評価の推移をお示ししております。いずれの項目も、ここ 10 年で上位評価の割合は増加しております。

また、年度によって上下動がありますことから、これらの傾向を捉えるために上位評価については 3 年移動平均をとり、オレンジ色の線として青色の折れ線に重ねております。折れ線の下側には評価の割合と推移の 2 つの観点で表を追加しております。評価の割合については上位評価の割合が 60%以上を◎、50%未満のものを△、50%以上 60%未満を○として整理しております。

また、推移については、オレンジ色の 3 年移動平均に関しまして、全期間の平均の変化量と直近 2 期の変化量を比較して、直近 2 期の 3 年移動平均の変化量が全期間の平均を上回っている場合は◎、下回っている場合は△、両者が含まれる場合には○として整理しております。この表の◎、○、△の整理は意匠、商標も同様となっております。

こちらのスライド 10 を御覧いただきまして評価できる項目、特許庁の強みについて、また限られたリソースの中で優先的に取り組むべき項目について御意見をいただければと思っております。

スライド 11 は、PCT についてもアンケートを実施しておりますので、スライド 10 と同様に整理したものでございます。

特許は以上となります。

○下村意匠課長 それでは続きまして、意匠について御説明させていただきます。

スライド 12 ページを御覧ください。こちらは意匠の審査業務の流れと業務の概要となっております。先ほど御説明のありました特許審査とおおむね同様の内容となっておりますので、御説明を割愛させていただきます。

スライド 13 ページを御覧ください。こちらは意匠審査全般についての上位評価の割合をお示ししております。意匠審査につきましては、2015 年からユーザー評価調査を開始いたしました。この間の品質管理の取組におきまして、ユーザーの皆様や専門的な御知見を有する皆様方から有益なコメントをいただいておりますこと、それから制度改正に即した審査の環境整備などを受けまして、徐々に上位評価の割合は高くなってきております。

14 ページは、各項目に関する評価の推移でございます。まず、こちらのページはサーチの的確性についてでございます。以前より意匠分類の詳細な付与ルールを記載しました分類・定義カードを作成しまして、審査官が随時参照できるようにするとともに、特許庁 Web サイトで公開したり、また、出願資料以外の公知資料を収集いたしまして、審査の的確性に資するデータベースの構築などを行ってきておりました。令和元年の意匠法改正以降は、改正によって新たな保護対象となりました、意匠の審査に必要な資料の収集にも注力しております。

15 ページは、判断の均質性についてでございます。こちらの項目は調査開始以降、上位評価の割合が低かったこともございまして、重点的な対応項目として取り組んでまいりました。特に国際出願や判断の難しい案件、それから新しい保護対象の分野では慎重な判断が必要となる案件について、案件協議を実施してまいりました。

また、2020 年からは審査官が他の審査官の拒絶理由通知の記載文を簡便に検索できるアプリなども提供してまいりました。

16 ページは、起案の記載内容のわかりやすさについてです。グラフ中、拒絶理由通知等が薄い青のラインで、拒絶査定につきましては紺色のラインでございます。こちらの項目につきましては制度改正や審査の運用変更に即しまして、審査の関連部署の整備等を行ってまいりましたほか、先ほど御紹介いたしました起案文、検索アプリの審査官への提供などを行ってまいりました。

17 ページは、面接、電話等における審査官とのコミュニケーションについてです。ここ 1～2 年は感染症拡大の状況を受けまして、対面でのコミュニケーションに制限がございましたけれども、特・実分野と同様に電話連絡手段の整備や、Web 会議サービスの拡充等の対応を行ってまいりました。

18 ページは、これまでの全項目を一つに総括したものでございます。俯瞰してみますと、上位評価の割合は徐々に上がってきている傾向もございしますが、まだ他の項目に比して課題が残る項目もございます。意匠分野におきましても今後どのような課題に注力してまい

るべきか、先生方の御意見を伺えれば幸いです。

意匠については以上となります。

○高野商標課長 商標課長の高野でございます。商標について、引き続き御説明させていただきます。

まずスライド 19 でございますが、こちらは商標審査業務の概要、審査の流れをあらわしている図でございます。

スライド 20 は、商標審査全体の上位評価の割合でございます。商標についても 2015 年から品質管理の取組を始めておりますが、おおむね横ばいで推移しており、約 50%前後の上位評価をいただいているところでございます。

スライド 21 は判断の項目でございますが、具体的には審査官間の判断の均質性ということで、先ほどいろいろ御意見をいただいた項目でございます。こちらもおおむね横ばい、少し右肩上がりではございますが、上位評価の割合は 30 数%ということでそれほど高くない数値で推移してございますので、我々の重点課題として引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。

スライド 22 は、起案の項目でございます。拒絶理由通知書及び拒絶査定のわかりやすさということでございますが、こちらもおおむね 50%前後で横ばいで推移してございます。

スライド 23 は、面接等ということでコミュニケーションの項目でございますが、こちらもおおむね横ばいではございますが上位評価の割合は 70%前後ということで、比較的高い評価をいただいているところでございます。

スライド 24 は、商標についての各項目の一覧表でございます。「普通以上」という緑のグラフですと 80%以上という高い評価をいただいておりますが、「満足・比較的満足」の青いグラフについてはまだまだ改善の余地があると思いますので、こちらを今後も高めるように、引き続き努力を続けてまいりたいと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

○井上（由）委員長 ありがとうございました。

事務局からの報告につきまして、御意見のある方は挙手、または御発言希望の旨をチャット欄に御記入ください。

大須賀委員、よろしくお願いします。

○大須賀委員 意匠の関係で、拒絶理由通知がわかりにくいというご指摘があるというこ

とについては、そういうことがあるのではないかと思います、その元をたどると意匠審査基準自体が、例えば公知意匠であっても必ずしもそれが排除されないとか、非常に総合的な判断になっておるといふ点があるのではないかと思います。

侵害訴訟の場合は要部を取り出してそこで判断するという、ある意味クリアな判断で行っているようなところもあるのに対して、審査のほうは必ずしもそういう要部的な考えはとっておられない。それが別に正しくないというわけではないのですが、審査基準自体に非常に複雑性があると思っています。

ですから、その審査基準との関係で、拒絶理由通知の評価が低いということを考えていく必要があるのかなという感じがしております。

○井上（由）委員長　ありがとうございました。

○下村意匠課長　意匠の下村でございます。ただいま大須賀委員から御指摘いただきました類否判断のユーザーさんへの御理解度の向上でございますが、御指摘いただきましたとおり、意匠の類否判断のロジック自体が、ユーザーさんに十分御理解いただけないところで、今回の評価結果でも「悪い」という評価をくださったケースもございました。先般、1社に訪問したところ、運用自体がこうなっているというロジック自体を、十分に御理解していただけていないところもございまして、そのかけ違いから、どうしてこんな審査結果が来るのかなという、悪い御評価をいただいたところもございました。

ですので、私ども、ユーザーの皆様との対話を重ねながら、私どもの審査基準の浸透や、審査の考え方をお伝えしていくということを、今後も鋭意取り組んでいかななくてはならないと痛感したところでございます。今後、そういったところにも注力してまいりたいと思います。

○井上（由）委員長　ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。

本多委員、お願いいたします。

○本多委員　表の見方を質問させていただきます。例えば特許のスライド9では線が2020年から2021に向かって下降気味と見るべき状況なのでしょうか。商標につきましては、審査官の判断の均質性が、スライド21、22ページにおいて、2020年から2021年に向かって下降気味、次のページも同様ですが、これは2020年に比べて2021年の評価が下がってしまったという見方でよろしいのでしょうか。

○船越品質管理室長　ありがとうございます。単年単年で比較いたしますと、単年ごとに増減はあるかと思っております。ただ、今回は傾向を捉えるということで、それらの増減

を全体としてどう見るかといった点では、オレンジ色の線をお示しさせていただきましたので、オレンジ色の線で御意見を賜れればと思います。

また、各年度の下がった要因ですが、今年度もそうなのですが、特にコメントのほうからは、どういったところかということが分析できない状況でございます。ただ、今年度は「不満」と答えた方については、どういった点で不満があったのかといった点は意見交換をさせていただいておりますので、この点はしっかりと対応させていただきたいと思っております。

○本多委員 ありがとうございます。理解いたしました。

○井上（由）委員長 ほかにございますでしょうか。

もし、できましたら皆様から一言ぐらいずつ頂戴できればと思っておりますけれども、菅原委員、お願いいたします。

○菅原委員 ありがとうございます。特許の 10 ページの判断の均質性の評価の割合が△になっていて、推移も△になっているところで、「優先的に取り組むべき項目は」と言われて、このグラフを見ると判断の均質性を課題にするというのが、ここから読み取れるのかなと思っておりますが、この判断の均質性というのが、いわゆる本当に審査官の間の均質性だけなのか、それとも判断の妥当性でしょうか。いわゆる意見書を読んだ結果翻った内容ですとか、審判などで別の審判官、合議体が検討して翻った内容の割合なども含んでのものなのでしょうか。そのあたりを御説明いただければと思います。

○船越品質管理室長 ありがとうございます。こちらについてはユーザーの皆様との意見交換の中では、審査官間の判断の均質性に関する御意見を多くいただいている状況でございます。

○菅原委員 はい、わかりました。ありがとうございます。その原因が何なのかというところに判断の妥当性がもしかするとあるかもしれないくて、似たような案件で、例えば 36 条違反を通知する審査官としない審査官がいるとか、ほかの技術分野を進歩性のところですごく関連性が低い副引例を挙げてくる審査官がいる一方で、似たような出願の場合は違いですとか、そういう単純な審査官の間の判断の均質性なのかどうかというのが、特許の場合は割れるところがあると思うので、もし今後、判断の均質性の評価の検討に取り組んでいかれる場合は、審査官の間の判断の違いが何に起因するのかも考えていくといいのかなと思っております。

それから面接のところも少し気になるのですが、新しく Web 面接などが入って、今後ど

んどん満足度は高まっていくのかなと思うのですが、近年すごく面接の「比較的満足」が向上していると思うのですが、これは何か理由があるものなのでしょうか。

○船越品質管理室長 ありがとうございます。今の菅原委員の御質問は、面接のところでしょうか。

○菅原委員 そうですね、面接のところですよ。

○船越品質管理室長 ありがとうございます。こちらはコメントを見る限りでは、こういう状況下でもオンラインでの面接が増えてきたということで、御評価いただいているかと思っています。

ただその一方で、昨年度の審査に対する御評価として、もっと使い勝手がいいものがあったらいいという御意見をいただき、今年度はTeamsの運用をさせていただいたところで。こういった形でまた対応を進めさせていただければと思います。

○菅原委員 わかりました。ありがとうございます。

私からは以上で大丈夫です。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

井上委員、近藤委員、別宮委員、もし何かありましたらお願いいたします。特段なければもちろん結構でございますけれども。

別宮委員、お願いいたします。

○別宮委員 別宮でございます。まずはこういった分析をしていただいたこと、ありがとうございます。ユーザーの評価結果を非常に細かく見える化していただいて、非常にわかりやすかったなと思います。

質問などではないのですが、事務局からも御説明ありましたが、この結果を踏まえて、次に満足度の低い項目についてなぜなのかと、もう一段負深掘りしてアクションをとっていただくというのが一番大事だと思います。事務局からの御説明でもその趣旨のお話がありましたが、これを引き続き推進していただければと思います。ありがとうございました。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

近藤委員、お願いいたします。

○近藤委員 近藤です。先ほどからコメントは入れたのですが。

○井上（由）委員長 すみません、チャットをいただいておりますか。失礼いたしました。お願いいたします。

○近藤委員 このような年度推移を見ていくのは非常に重要なことだと思っていますので、

今後も続けていただきたいというのが1点です。

それから、先ほどの評価や提案のところでは、このアンケートに基づいたコメントを差上げたので、そこについては重複しますのでやめておきますが1点だけ追加でコメントさせていただきます。特許の外国特許文献や非特許文献の調査のところが、少し評価が低いところが見られるのですが、それを対応するに当たって、評価が低いから一律に単純に調査を強化していくというものでは、効率の観点からも、それはどうかなと思いますので、技術分野によって対応を変えるだとか、どこをどうすればそこはよくなるのだというのを、もう少し深掘りしながら対応を考えていただければと思います。

全体的に言えるコメントとしては、先ほども少し申し上げましたが、長年かかって評価が思うように伸びてこない部分というのは、その対応を継続することの妥当性も含めて検証していただきたいと思います。

以上です。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

井上委員、何かございますでしょうか。

○井上（涉）委員 ありがとうございます。私も質問は特にございません。ただ、このように評価の推移を出していただくということは、強みと弱みが一目瞭然で、非常にわかりやすいので大変歓迎しております。

今後も毎年こういったデータを出していただいて、このデータを庁内でベンチマークとしていただいて、取組をさらに強化していただきたいと思っております。

以上でございます。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。皆様から御意見をいただきました。私も今回のようなユーザー評価の推移をわかりやすく見せるような形で御報告いただいたのは、大変ありがたいと思っております。取り組むべき項目も明確になってきたように思います。

近藤委員からも御意見ありましたけれども、今回は「不満足」の回答率が表の中には出てきていないのですが、事務局からの御説明では「不満足」の回答について図示しようと思っても、うまい形で見せることができなかったというお話を伺いました。それに加えて、事務局のほうでは「不満足」の回答者にヒアリングして、不満を持っておられる方にもしっかりリーチしていただいているということだと思います。今後もそうしたことを続けていただきたいと思っております。

それでは皆様、大変貴重な御意見いただきましてありがとうございました。各委員から

いただきました御意見については、今後の審査関連施策に生かしていきたいと思います。
ありがとうございます。

今後のスケジュールについて

○井上（由）委員長 では最後に、今後のスケジュールについて事務局からお願いいたします。

○船越品質管理室長 次回の委員会では、皆様からいただきました改善提案に基づき、本小委員会の改善提言及び審査品質管理小委員会報告書（案）につきまして、御審議いただく予定です。開催は3月18日金曜日を予定しております。

○井上（由）委員長 ありがとうございます。

それでは以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会令和3年度第1回審査品質管理小委員会を閉会いたします。

本日は長時間御審議いただきまして、ありがとうございました。

閉 会